

# Deutsche Akkreditierungsstelle

## Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab: 08.05.2024**

Ausstellungsdatum: 08.05.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**Atotech Deutschland GmbH & Co. KG**  
**Erasmusstraße 20, 10553 Berlin**

mit den Standorten

**Atotech Deutschland GmbH & Co. KG**  
**Analytics und Materials Science**  
**Erasmusstraße 20, 10553 Berlin**

**Atotech Deutschland GmbH & Co. KG**  
**Analytics und Materials Science**  
**Analytiklabor**  
**Ahornallee 4, 16818 Werder**

**Atotech Deutschland GmbH & Co. KG**  
**Analytics und Materials Science**  
**Untergasse 47, 65468 Trebur-Geinsheim**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

**chemische Untersuchung von Industriechemikalien, Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern mittels chromatographischer, spektrometrischer und titrimetrischer Verfahren;**

**Innerhalb der mit \*\* gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

**Dem Prüflaboratorium am Standort Werder (Neuruppin) ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung von Hausverfahren des Standorts Berlin in den Prüfbereichen 2.1, 2.3 - 2.7 sowie 2.9 - 2.10 gestattet.**

**Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft.**

**Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**

**Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

Die Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an denen sie durchgeführt werden.

Die Kennzeichnung B (Berlin), NP (Werder) und TR (Trebur-Geinsheim) hinter den Prüf- und Probenahmeverfahren zeigt den Standort an, für den die Kompetenz bestätigt wird.

- B = Atotech Deutschland GmbH & Co. KG, Standort Berlin
- NP = Atotech Deutschland GmbH & Co. KG, Standort Werder (Neuruppin)
- TR = Atotech Deutschland GmbH & Co. KG, Standort Trebur

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

**1 Metallische Schichten und Überzüge**

DIN EN ISO 3613 2011-04	Metallische und andere anorganische Überzüge - Chromatierüberzüge auf Zink, Cadmium, Aluminium-Zink- und Zink-Aluminium-Legierungen - Prüfverfahren	B, TR
DIN EN 1811 2015-10	Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit von sämtlichen Stäben, die in durchstochene Körperteile eingeführt werden und Erzeugnissen, die unmittelbar und länger mit der Haut in Berührung kommen	B
DIN EN 62321 2009-12; VDE 0042-1 2009-12	Produkte in der Elektrotechnik - Bestimmung von Bestandteilen der sechs Inhaltsstoffe (Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl, polybromierter Diphenylether), die einer Beschränkung unterworfen sind (Einschränkung: <i>nur für Blei, Chrom, Cadmium und sechswertiges Chrom</i> )	B, TR
DIN EN 62321-3-1 2014-10; VDE 0042-1-3-1 2014-10	Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der Elektrotechnik - Teil 3-1: Screening - Blei, Quecksilber, Cadmium, Gesamtchrom und Gesamtbrom durch Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie	B
DIN EN 62321-5 2014-10; VDE 0042-1-5 2014-10	Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der Elektrotechnik - Teil 5: Cadmium, Blei und Chrom in Polymeren und Elektronik und Cadmium und Blei in Metallen mit AAS, AFS, ICP-OES und ICP-MS (Einschränkung: <i>nur ICP-OES</i> )	B, TR
DIN EN 62321-7-1 2016-09; VDE 0042-1-7-1 2016-09	Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der Elektrotechnik - Teil 7-1: Bestimmung des Vorliegens von sechswertigem Chrom (Cr(VI)) in farblosen und farbigen Korrosionsschutzüberzügen auf Metallen durch das kolorimetrische Verfahren	B, TR

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

**2 Untersuchung von Industriechemikalien**

**2.1 Titrimetrische Bestimmung von Elementen und Anionen in Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern (\*\* B und TR)**

AV-A0000364 2018-10	Bestimmung von Nickel im Nickel-Elektrolyt mittels Komplexometrie	B, NP
AV-A0000410 2015-06	Bestimmung von Kupfer im Kupfer-Elektrolyt mittels Komplexometrie	B, NP
AV-A0000350 2011-03	Bestimmung von Cr(VI) im Chrom-Elektrolyt und Beizen mittels Redox-Titration	B, NP
AV-A0000430 2010-12	Bestimmung von Cr(VI) im Chrom-Elektrolyt und Beizen mittels Redox-Titration	B
PV-11321TIT 2009-01	Bestimmung von Sn(II) im Aktivator mittels Redox-Titration	B, NP
AV-A0000082 2011-03	Bestimmung von Natriumhypophosphit im Nickel-Elektrolyt mittels Redox-Titration	B, NP
AV-A0000480 2018-10	Bestimmung von Chlorid im Nickel-Elektrolyt mittels Fällungstitration	B, NP
AV-A0000353 2011-03	Bestimmung von Chlorid im sauren Zink-Elektrolyt mittels Fällungstitration	B, NP, TR
AV-A0000412 2018-10	Bestimmung des Gehaltes an Chlorid im Kupfer-Elektrolyt mittels Fällungstitration	B, NP
AV-A0000026 2013-12	Bestimmung von Schwefelsäure im Kupfer-Elektrolyt mittels Alkalimetrie	B, NP
AV-A0000352 2018-10	Bestimmung von Borsäure im Zink- oder Nickel-Elektrolyt mittels Alkalimetrie	B, NP, TR
AV-A0000398 2019-08	Bestimmung von Natronlauge im Zink- oder Zink/Nickel-Elektrolyt mittels Acidimetrie	B, NP, TR
AV-A0001447 2018-03	Bestimmung von Netzmittel im Cleaner mittels Tensid-Titration	B
PV-9289-TIT 2017-02	Bestimmung von Netzmittel im Conditioner mittels Tensid-Titration	B

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

AV-A0000284 2011-06	Bestimmung von Gesamtsäure in Zinn-Elektrolyt mittels Alkalimetrie	NP
------------------------	---	----

**2.2 Bestimmung von organischen Inhaltsstoffen in Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern mittels Gaschromatographie mit konventionellem Detektor (FID) \*\***

PV-10595GC 2019-01	Ethylenglykol und Diethylenglykol-monobutylether (Butyldiglykol) im Queller mittels GC-FID	B
-----------------------	---	---

PV-14215GC 2019-01	Diethylenglykol-monobutylether im Ätzreiniger mittels GC-FID	B
-----------------------	--	---

**2.3 Ionenchromatographische Bestimmung von organischen und anorganischen Inhaltsstoffen in Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern (\*\* B)**

PV-9796-IC 2019-07	Bestimmung von Hypophosphit und Methansulfonsäure im Zinn-Elektrolyt mittels Ionenchromatographie	B, NP
-----------------------	--	-------

AV-A0000447 2018-09	Bestimmung von Chlorid, Sulfat, Nitrat, Phosphat und Katalysator C im Chrom-Elektrolyt mittels Ionenchromatographie	B, NP
------------------------	---	-------

PV 13832IC 2015-03	Bestimmung von Katalysator N und T in Chrom-Additiv mittels Ionenchromatographie	B, NP
-----------------------	---	-------

AV-A0002346 2019-07	Bestimmung von Stabilisator C1 und C2, BluCr B und Sulfat im Tri-Chrom-Elektrolyt mittels Ionenchromatographie	B
------------------------	---	---

AV-A0002741 2016-10	Bestimmung von Ammonium in aufbereiteten Spülwässern mittels Kationen-IC	B
------------------------	---	---

PV-13016IC 2017-12	Bestimmung von Komplexer im Palladium-Elektrolyt mittels Kationen-IC	B
-----------------------	---	---

AV-B0002064 2018-09	Bestimmung von Nitrat im Nickel-Elektrolyt mittels IC-UV	B
------------------------	--	---

PV-12957IC 2015-06	Bestimmung von Nitrat in Kupfer-Additiven mittels IC-UV	B
-----------------------	---	---

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

**2.4 Bestimmung von organischen Inhaltsstoffen in Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern mittels Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV, CA, RI, ELS) (\*\* B und TR)**

PV-12574LC 2010-09	Bestimmung von Komplexbildnern im Nickel-Konzentrat mittels LC-UV	B, NP
PV-11011LC 2017-04	Bestimmung von Glanzzusatz im Kupfer-Konzentrat mittels LC-UV	B, NP
AV-B0000444 2010-06	Bestimmung von Komplexbildnern im Nickel-Elektrolyt mittels LC-UV	B, NP
AV-B0001719 2019-07	Bestimmung von Netzmittel im Nickel-Elektrolyt mittels LC-CAD	B
AV-A0003069 2018-01	Bestimmung von Carrier im Zink/Nickel-Elektrolyt mittels LC-CAD	B, TR
AV-B0002095 2019-03	Bestimmung von Carrier im Zink/Nickel-Elektrolyt mittels LC-UV	B, TR
AV-A0002464 2016-10	Bestimmung von Neolink E3 im Kupfer-Elektrolyt mittels LC-RI	B
AV-B0001325 2017-11	Bestimmung von Polymeren im Zinn/Silber-Elektrolyt mittels LC-ELSD	B
EPA 8315A (SW-846) 1996-12	Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Einschränkung: <i>nur für Formaldehyd und Derivatisierung nach 7.3.1 oder 7.3.4</i> )	B

**2.5 Bestimmung von Elementen und Anionen in Salzlösungen, Metalllösungen, Galvanikbädern und Wässern mittels Photometrie (\*\* B und TR)**

AV-B0000831 2007-09	Bestimmung von Nitrat im Nickel-Elektrolyt mittels Photometrie	B, NP, TR
PV-14363UV 2014-07	Bestimmung von Stabilisator im Kupfer-Konzentrat mittels Photometrie	B, NP
AV-A0001866 2013-01	Bestimmung von Ammonium im sauer Zink- oder Tri-Chrom-Elektrolyt mittels Photometrie	B, TR

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

AV-A0000283 2001-09	Bestimmung von Thioharnstoff im Zinn-Elektrolyt mittels Photometrie	B, NP, TR
------------------------	--	--------------

**2.6 Bestimmung von Elementen in Salzlösungen, Metalllösungen, Galvanikbädern und Wässern mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (\*\* B und TR)**

AV-A0001757 2014-05	Bestimmung von Eisen im Chrom-Elektrolyt mittels Atomabsorptionsspektrometrie	B
AV-A0000170 2015-11	Bestimmung von Nickel im Zn-Ni-Elektrolyt mittels Atomabsorptionsspektrometrie	B, NP, TR
AV-A0000171 2015-11	Bestimmung von Zink im Zn-Ni-Elektrolyt mittels Atomabsorptionsspektrometrie	B, NP, TR
AV-A0000156 2010-11	Bestimmung von Palladium im Aktivator mittels Atomabsorptionsspektrometrie	B, NP
PV-14544AAS 2017-01	Bestimmung von Gold (Au) in Rohstoffen mittels Atomabsorptionsspektrometrie	B, NP
PV-15606AAS 2018-05	Bestimmung von Natrium und Kalium in stromlos Kupfer- Additiven mittels Atomemissionsspektrometrie	B, NP

**2.7 Bestimmung von Elementen in Salzlösungen, Metalllösungen, Galvanikbädern und Wässern mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) (\*\* B und TR)**

PV-10348ICP 2006-01	Bestimmung von As, Ca, Cr, Mg, Ni, Pb, Sb und Sn im Kupfer- Konzentrat mittels ICP-OES	B, NP
PV-14589ICP 2014-12	Bestimmung von Eisen in Reduktionslösung mittels ICP-OES	B, NP
AV-B0000340 2019-09	Semiquantitatives Screening auf 47 Elemente in Metallsalzlösungen mittels ICP-OES	B, NP, TR
PV-14511ICP 2014-10	Bestimmung von Ag, As, Cd, Co, Cr, Fe, In, Mg, Mn, Ni, Pb, Sn, Tl, Zn im Kupfer-Additiv mittels ICP - OES	B, NP, TR
PV-14043ICP 2017-08	Bestimmung von Pt, Rh und Ru in Palladium-Stammlösung mittels ICP - OES	B

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

PV-11069ICP 2018-08	Bestimmung von Ca, Cr, Cd, Mg, Ni, Pb, As, Sb, Sn in Kupfer-Grundelektrolyt mittels ICP-OES	B, NP
PV-14872ICP 2019-06	Bestimmung von K, Ca, Mg, Cr, Ni, As, Sb, Sn in organischen Additiven für Kupfer-Elektrolyte mittels ICP-OES	B, NP

**2.8 Bestimmung von Elementen in Salzlösungen, Metalllösungen, Galvanikbädern und Reinstwässern mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppelten Plasma (ICP-MS) \*\***

PV-15526PMS 2018-05	Al, Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Li, In, Mg, Mn, Pb, Sn, Si, Sr, Ti, V, W und Zn in stromlos Kupfer-Additiven mittels ICP-MS	B
AV-A0002902 2017-12	Ag, As, Bi, Cd, Fe, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Te, und Zn in Kupfer-Anoden mittels ICP-MS	B

**2.9 Elektrochemische Verfahren zur Bestimmung von Elementen und organischen Inhaltsstoffen in Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern (\*\* B)**

AV-A0001611 2011-12	Bestimmung von Pb und Cd im Nickel-Elektrolyt mittels Polarographie	B, NP
AV-A0002353 2015-11	Bestimmung von Bi im Nickel-Elektrolyt mittels Polarographie	B, NP
PV-14659POL 2015-10	Bestimmung von Sn(II) im kolloidalen Sn-Pd-Aktivator mittels Polarographie	NP
AV-A0001742 2012-01	Bestimmung von Einebner im Kupfer-Elektrolyt mittels Voltammetrie	B, NP
AV-A0001741 2012-03	Bestimmung von Glanzzusatz im Kupfer-Elektrolyt mittels Voltammetrie	B, NP
PV-9666-CVS 2019-05	Bestimmung der Aktivität von Glanzzusätzen in organischen Additiven mittels Voltammetrie	B, NP
PV-9659-CVS 2019-05	Bestimmung der Aktivität von Einebnern in organischen Additiven mittels Voltammetrie	B, NP
AV-A0000787 2018-08	Bestimmung von Korrekturlösung im Kupfer-Elektrolyt mittels Voltammetrie	B, NP

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14564-01-01**

**2.10 Physikalische und physikalisch-chemische Untersuchung von Rohstoffen, Salzlösungen, Metalllösungen und Galvanikbädern (\*\* B und TR)**

PV-5360-PHY 2008-06	Bestimmung der Dichte mit dem Biegeschwing- Messgerät	B, NP, TR
PV-5686-PHY 2019-01	Bestimmung des pH-Wertes	B, NP, TR

**Verwendete Abkürzungen:**

AV	Hausverfahren der Atotech Deutschland GmbH & Co. KG
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
PV	Hausverfahren der Atotech Deutschland GmbH & Co. KG